

На рис. 5, б показан участок поверхности тройного соединения $\text{Cd}_{0.2}\text{Hg}_{0.8}\text{Te}$ после обработки в условиях атмосферы ($t = 5$ с, $s_0 = 5$ кВт/см 2). Характерные искажения вызваны испарением и плавлением вещества вне области облучения, которые обусловлены теплопроводностью материала.

Обработка в откачиваемой камере приводит к существенному улучшению качества обработки полупроводника $\text{Cd}_{0.2}\text{Hg}_{0.8}\text{Te}$ (рис. 5, в, г, давление остаточного газа в камере $4-10^{-2}$ мм рт. ст., $t = 1$ мин, $s_0 = 5$ кВт/см 2). В этом случае удаление вещества из зоны обработки происходит путем прямого испарения вещества за счет абляционных процессов.

Таким образом, описанная в настоящей работе установка может найти применение в различных областях обработки материалов лазерным излучением. Результаты, полученные в данной работе, позволяют правильно выбирать конструкцию установки и определять условия ее эксплуатации в зависимости от требований и характера решаемых задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Петраш Г. Г. Усилители яркости для оптических приборов // Вестник АН СССР.—1982.—№ 2.
- Земсков К. И., Казарян М. А., Петраш Г. Г. и др. Внутрирезонаторная обработка объектов в активной оптической системе // Кр. сообщ. по физике ФИАН СССР.—1988.—№ 5.
- Земсков К. И., Исаев А. А., Казарян М. А., Петраш Г. Г. Исследование основных характеристик лазерного проекционного микроскопа // Квантовая электроника.—1976.—3, № 1.
- Джеррард А., Берч Дж. М. Введение в матричную оптику.—М.: Мир, 1978.

Поступило в редакцию 28 июля 1989 г.

УДК 535.3 : 681.3

А. Г. КОНИХОВ, Е. Н. ПАВЛОВ, В. Ф. ТЕРЗИ
(Казань)

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЗОТРОПНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ ЭКРАНОВ

Синтезированные амплитудно-фазовые случайные экраны играют важную роль во многих задачах оптической обработки изображений [1, 2], а также при имитации переноса изображений через турбулентную или рассеивающую атмосферу [3, 4]. Существующие алгоритмы моделирования таких случайных экранов [5] являются слишком медленными (требуют большого времени счета) и весьма трудоемки при контроле оптических характеристик синтезированных экранов (необходимо выполнить прямое и обратное преобразование Фурье).

Настоящая работа посвящена разработке и реализации эффективного алгоритма моделирования случайных однородных и изотропных полей, при помощи которых можно синтезировать случайные поглощающие и фазовые экраны более широкого класса, чем используемые диффузоры [6] или «шахматные» экраны [1, 4].

Методика расчета. По аналогии с одномерным процессом авторегрессии (AP) [7] введем двумерный процесс AP в виде

$$X(n, m) = \sum_{l=-M}^{-M} \sum_{k=-M}^{-M} F(l, k) X(n-l, m-k) + U_\sigma(n, m), \quad (1)$$

где $(2M+1) \times (2M+1)$ — область определения элементов матрицы $F(l, k)$; $U_\sigma(n, m)$ — белый шум с дисперсией $(\sigma_U)^2$; n, m — номера элементов матрицы дискретного случайного поля $X(n, m)$.

Наиболее простая модель двумерного процесса AP — представление случайного поля в виде одномерных процессов AP первого порядка [7] по строкам, столбцам и диагонали матрицы поля, т. е.

$$X(n, m) = AX(n, m-1) + BX(n-1, m) + CX(n-1, m-1) + U_\sigma(n, m). \quad (2)$$

Последовательность элементов матрицы (1) или (2) вдоль различных направлений соответствует одномерному процессу AP. Значения коэффициентов A, B, C должны удовлетворять условиям стационарности и обратимости процесса. Автокорреляционная функция ρ , дисперсия σ_x^2 и спектр мощности $S(v, \alpha)$ случайного поля (2) вдоль

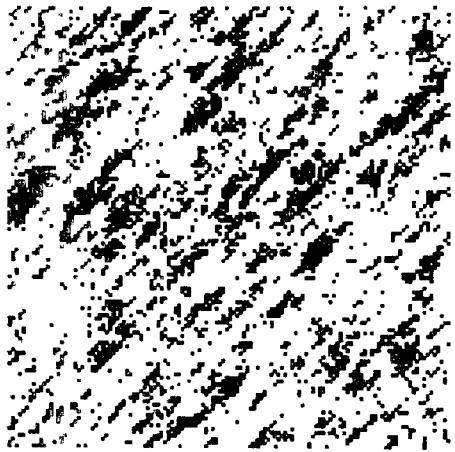


Рис. 1. Бинарное представление коррелированного случайного поля размером 128×128 элементов (параметры $A = B = C = 0,3$, дисперсия $\sigma_u^2 = 1,0$) с пороговым уровнем 1,0

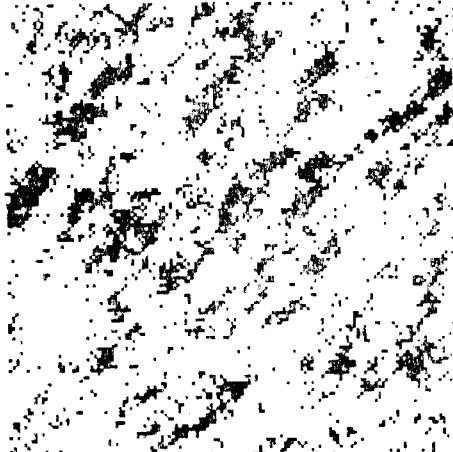


Рис. 2. Бинарное представление однократно сглаженного коррелированного случайного поля.
Параметры те же, что и для рис. 1

различных направлений описываются так же, как для одномерных процессов АР p -го порядка [7]:

$$\rho_k(s, \alpha) = f_1 \rho_{k-1} + f_2 \rho_{k-2} + \dots + f_p \rho_{k-p}; \quad (3)$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sigma_u^2}{[1 - f_1 \rho_1 - f_2 \rho_2 - \dots - f_p \rho_p]^2}; \quad (4)$$

$$S(v, \alpha) = \frac{2\sigma_u^2}{[1 - f_1 \exp(-j2\pi v) - \dots - f_p \exp(-j2\pi p v)]^2}, \quad (5)$$

где f_i — коэффициенты, определяемые через элементы матрицы F вдоль направления α на расстоянии s от центра; v — пространственная частота вдоль направления α . Из выражений (3)–(5) видно, что подбором коэффициентов f_i или элементов матрицы F (в частности, A, B, C) можно моделировать различные случайные поля с заданными значениями ρ , σ_x^2 и $S(v, \alpha)$.

Результаты моделирования случайных полей по алгоритму (2) представлены на рис. 1–3. На рис. 1 приведено бинарное представление случайного $X(n, m)$ поля размером 128×128 элементов для $A = B = C = 0,3$, $\sigma_u^2 = 1$. На рис. 2 и 3 даны бинарные представления случайного поля $X(n, m)$ после однократного и четырехкратного сглаживания фильтром $F(l, k)$ по алгоритму (1) с элементами $F(l, k) = 1$ для $M = 1$. Как видно, из этих рисунков, диагональная анизотропия, наблюдавшаяся на рис. 1 и обусловленная несимметричным видом алгоритма (2), уменьшается на рис. 2 и почти исчезает на рис. 3. Количественно эти закономерности подтверждаются рис. 4–6. Автокорреляционная функция ρ_k случайных полей $X(n, m)$, бинарное представление которых приведено на рис. 1–3, вдоль различных направлений вычислялась из соотношений

$$\rho_k(1) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^N X(n, m-k) X(n, m); \quad (6)$$

$$\rho_k(2) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N X(n-k, m) X(n, m); \quad (7)$$

$$\rho_k(3) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N X(n-k, n-k) X(n, n). \quad (8)$$

Выражения (6)–(8) используются для вычисления автокорреляционных функций вдоль строки, столбца и диагонали матрицы $X(n, m)$. Величина $N+k$ не должна превышать длину строки или столбца поля $X(n, m)$. На рис. 4–6 приведены усредненные значения ρ_k вдоль различных направлений. Из рис. 4 видно, что для двух диагональных направлений ρ_k сильно отличаются друг от друга, а также от ρ_k вдоль строки и столбца. После однократного сглаживания поля $X(n, m)$ это отличие умень-

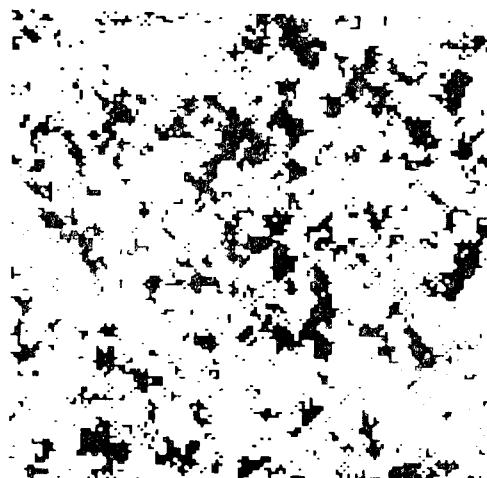


Рис. 3. Бипарное представление четырехкратного сглаженного коррелированного случайного поля
Параметры те же, что и для рис. 1

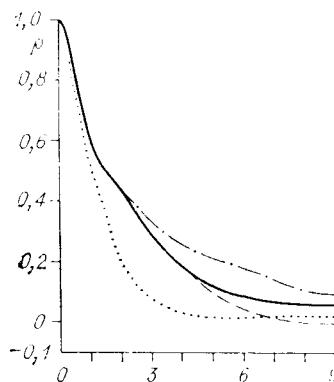


Рис. 5. Усредненные автокорреляционные функции однократно сглаженного случайного поля.
Обозначения те же, что и для рис. 4

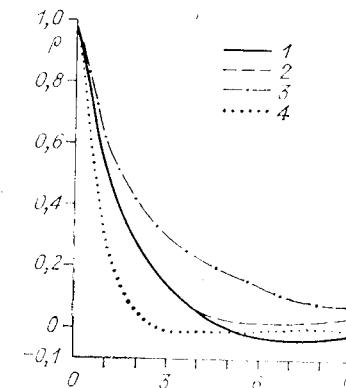


Рис. 4. Усредненные автокорреляционные функции случайного поля $X(n, m)$, сгенерированного по алгоритму (2), вдоль различных направлений:
1 — по строкам; 2 — по столбцам; 3 — по диагонали справа налево; 4 — по диагонали слева направо

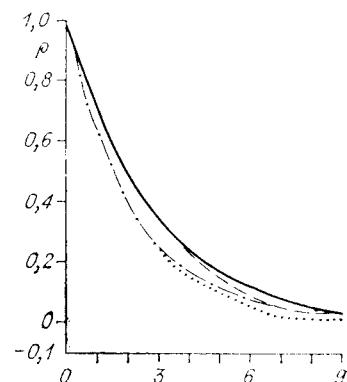


Рис. 6. Усредненные автокорреляционные функции четырехкратного сглаженного случайного поля.
Обозначения те же, что и для рис. 4

шается, а после четырехкратного сглаживания отличия становятся незначительными.

Моделирование случайных полей $X(n, m)$ выполнялось на мини-ЭВМ СМ-4 в операционной системе ОС — РВ, программы написаны на языке Фортран. Время синтеза одного случайного поля 128×128 элементов с 256 градациями яркости составляет 1,5 мин. Процесс однократного сглаживания при $M = 1$ занимает 1,2 мин машинного времени. Достигнутое время счета на два порядка меньше, чем при моделировании гауссовых коррелированных полей с использованием преобразований Фурье, и в 30 раз меньше, чем при использовании параметрической модели [5].

Случайные поглощающие экраны. Если случайное поле $X(n, m)$ ограничить областью определения $[0, 1]$ и изготовить соответствующий транспарант, амплитудный (по интенсивности) коэффициент пропускания которого

$$\tau(x, y) = X(n, m), \quad (9)$$

то такой случайный экран может стать чисто поглощающим элементом. Введение его между излучением и приемником по схеме оптического процессора [2] можно рассматривать как случайную аподизацию и исследовать ее влияние на качество изображения [4].

Случайный фазовый экран. Амплитудный коэффициент пропускания такого экрана имеет вид [4]

$$\tau(x, y) = \exp\{j\varphi(x, y)\}, \quad (10)$$

где $\varphi(x, y)$ — случайный фазовый сдвиг. Если ограничить область определения $X(n, m)$ отрезком $[0, 2\pi]$ и положить

$$\varphi(x, y) = X(n, m), \quad (11)$$

то случайная фаза $\varphi(x, y)$ будет обладать всеми свойствами случайного поля $X(n, m)$.

Технология изготовления случайных поглощающих и фазовых экранов описана в [8]. Например, изменение фазы $\varphi(x, y)$ может быть достигнуто либо изменением показателя преломления m_0 , либо изменением толщины экрана $h(x, y)$, либо тем и другим вместе. В случае «тонкого» экрана фазовый сдвиг равен

$$\varphi(x, y) = \frac{2\pi}{\lambda} [L(x, y) - L_0], \quad (12)$$

где $L(x, y) = hm_0$ в точке (x, y) ; L_0 — средняя оптическая длина пути; λ — длина волны излучения.

Бинарное представление случайных полей на рис. 1—3 получено путем пороговой бипаризации полуточковых случайных полей $X(n, m)$. Элементы поля с $X(n, m) > > 1$ показаны черным цветом, а элементы с $X(n, m) \leq 1$ — белым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оптико-электронные методы обработки изображений/Под ред. С. Б. Гуревича.—Л.: Наука, 1982.
2. Применение методов Фурье-оптики/Под ред. Г. Старка.—М.: Радио и связь, 1988.
3. Компьютеры в оптических исследованиях/Под ред. Б. Фридена.—М.: Мир, 1983.
4. Гудмен Дж. Статистическая оптика.—М.: Мир, 1988.
5. Шалыгин А. С., Палагин Ю. И. Прикладные методы статистического моделирования.—Л.: Машиностроение, 1986.
6. Обратные задачи в оптике/Под ред. Г. П. Болтса.—М.: Машиностроение, 1984.
7. Боке Дж., Дженинс Г. Анализ временных рядов.—М.: Мир, 1974.—Вып. 4.
8. Лукашова С. Г., Красюк И. К., Пашинин П. П., Прохоров А. М. Аподизация световых пучков как метод повышения яркости лазерных установок на неодимовом стекле // Труды ИОФАН.—М.: Наука, 1987.—Т. 7.

Поступило в редакцию 3 февраля 1989 г.

УДК 621.391

А. Н. КУЧЕНЕВ, Е. А. САМСОНОВА, Ю. М. СМИРНОВ
(Москва)

СГЛАЖИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РЕЛЬЕФА В ПРОТЯЖЕННЫХ ПУЧКАХ ЭЛЕКТРОНОВ НИЗКОЙ ЭНЕРГИИ

Применение протяженных электронных и атомных пучков позволяет существенно повысить эффективность экспериментов, выполняемых с целью исследования электрон-атомных столкновений [1, 2]. Вместе с тем, как и при появлении любой новой методики исследования, здесь возникает ряд факторов, влияющих на точность и надежность получаемых результатов.

Один из важнейших среди этих факторов — отрицательный объемный заряд электронного пучка в пространстве столкновений. В идеальном случае пространство столкновений должно быть эквипотенциальным с тем, чтобы скорость электронов при их движении в этой области была неизменной, а траектории не искались. В реальных пучках независимо от их протяженности это условие не выполняется, что приводит к неоднородному расхождению пучка и к отличию энергии электронов от значения, заданного на входе в пространство столкновений. Неодинакость отличия в различных элементах объема пучка вызывает эффективное уширение распределения электронов по энергиям.

Угловая расходимость пучка может быть существенно уменьшена применением продольного магнитного поля, которое, однако, не всегда желательно и допустимо. Другая возможность, реально используемая во многих современных экспериментах, — компенсация отрицательного объемного заряда электронов положительным зарядом медленных (околотепловых) ионов, образующихся в пространстве столкновений в результате ионизующих соударений электронов с атомами. При этом уменьшается влияние заряда пучка как на траектории, так и на энергию электронов, поскольку пространство столкновений в целом приближается к эквипотенциальному. Однако такая компенсация эффективна лишь при сравнительно высокой концентрации ато-